

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年12月30日(30.12.2021)



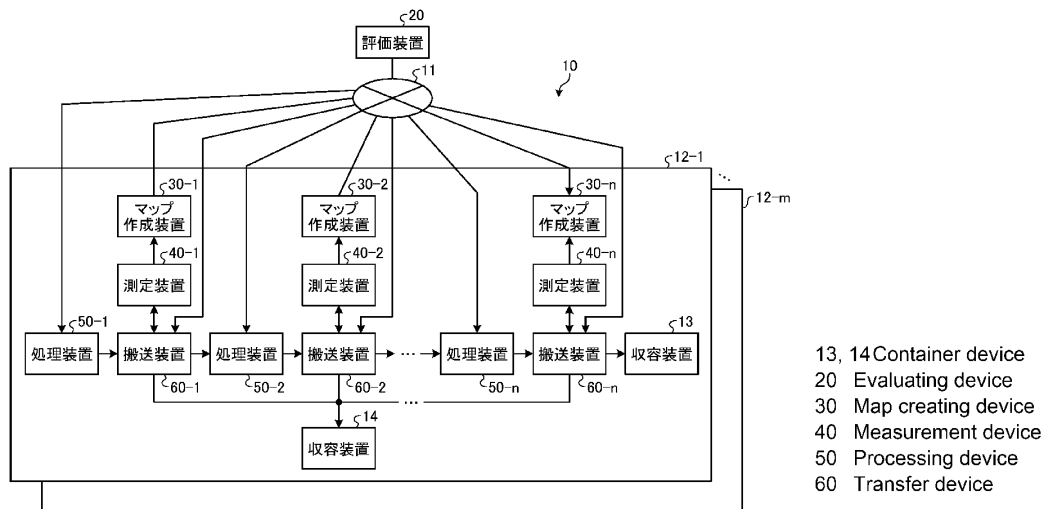
(10) 国際公開番号

WO 2021/261352 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/02 (2006.01) G05B 19/418 (2006.01)
H01L 21/66 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/022865
- (22) 国際出願日: 2021年6月16日(16.06.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2020-109003 2020年6月24日(24.06.2020) JP
- (71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 秋元 健司 (AKIMOTO, Takeshi); 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂ビズタワー 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人酒井国際特許事務所 (SAKAI INTERNATIONAL PATENT OFFICE); 〒1000013 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 虎の門三井ビルディング Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, KE, KG, KH,

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING SYSTEM, SUBSTRATE PROCESSING METHOD, AND MAP CREATING DEVICE

(54) 発明の名称: 基板処理システム、基板処理方法、およびマップ作成装置



(57) Abstract: This substrate processing system is provided with a measurement device, a transfer device, a map creating device, and an evaluating device. The measurement device measures an error in a substrate for which a first step has been performed by a first processing device for performing the processing of the first step with respect to a substrate. The transfer device transfers a substrate between a plurality of devices, including the first processing device, a second processing device for performing the processing of a second step which is performed with respect to a substrate after the first step, and the measurement device. The map creating device creates an error map for each substrate indicating an error distribution on the substrate. The evaluating device calculates an evaluation value for each substrate indicating the importance of an error on the basis of the error map. The evaluating device, in accordance with a result of determination

[続葉有]

WO 2021/261352 A1

KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

as to whether the evaluation value is greater than or equal to a predetermined first threshold value, indicates to the transfer device a transfer destination of a substrate for which the first step has been performed.

(57) 要約: 基板処理システムは、測定装置と、搬送装置と、マップ作成装置と、評価装置とを備える。測定装置は、基板に対して第1の工程の処理を行う第1の処理装置によって第1の工程が行われた後の基板のエラーを測定する。搬送装置は、第1の処理装置と、基板に対して第1の工程の後に行われる第2の工程の処理を行う第2の処理装置と、前記測定装置とを含む複数の装置間で、基板を搬送する。マップ作成装置は、基板毎に、基板上におけるエラーの分布を示すエラーマップを作成する。評価装置は、基板毎に、エラーマップに基づいてエラーの重要度を示す評価値を算出する。評価装置は、評価値が予め定められた第1の閾値以上か否かの判定結果に応じて、第1の工程が行われた後の基板の搬送先を搬送装置に指示する。